

サーマルCVD装置 CT-5500



サーマルCVD装置CT-5500はポリSi(第1炉)、SiO₂、PSG、BSG(第2炉)、Si₃N₄(第3炉)をコーティングできます。各炉は、それぞれ独立したCVD炉なので、異質物の混入がありません。1台で3台分の働きをする小ロット生産用CVDです。

サーマルCVD装置 CT-5500 仕様

○膜種	ポリSi/Si ₃ N ₄ /SiO ₂ /PSG/BSG
○炉体サイズ	φ154mm×1150mm
○炉体材質	石英
○基板形状	4インチ 10枚
○到達圧力	×10 ⁻² Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 ⁻¹ Pa台迄3分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○加熱温度	1000℃
○圧力コントロール	自動
○ガス種	SiH ₄ /O ₂ /NH ₃ /PH ₃ /B ₂ H ₆ /H ₂ /N ₂
○真空排気系	油回転ポンプ:375L/min メカニカルブースターポンプ:100m ³ /h
○真空計	ピラニ真空計/バロトロン真空計
○ユーティリティ	電気:AC200V三相40kVA 冷却水:25L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上